

การสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน

Synthesis of Zinc Oxide Nanostructures

ธีระพงษ์ แสนทวีสุข

Theerapong Santhaveesuk

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Faculty of Science, Pibulsongkram Rajabhat University

E-mail: s_theerapong@yahoo.co.th

(รับบทความเมื่อ 12 พฤษภาคม 2550; ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 29 มิถุนายน 2550)

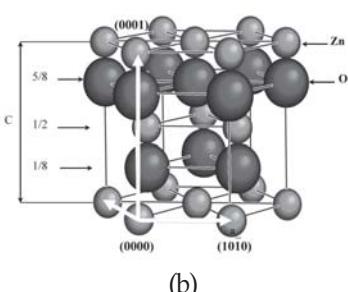
คำสำคัญ : อนุภาคนาโน สังกะสีออกไซด์ การปลูกผลึก

Keywords : Nanoparticles, ZnO, Crystal growth

สังกะสีออกไซด์ (ZnO) เป็นสารเคมีที่มีผลสีขาว น้ำหนักโมเลกุล 81.4 g/mol และมีโครงสร้างแบบ wurtzite (hexagonal) ลักษณะโครงผลึกของสังกะสีออกไซด์ แสดงดังรูป



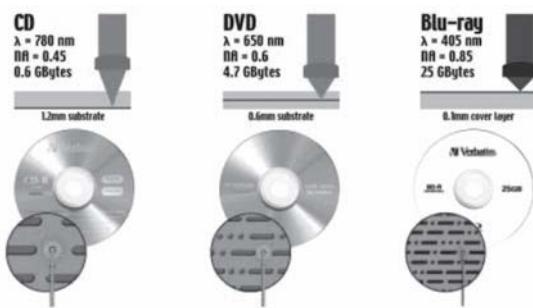
(a)



(b)

รูปที่ 1 (a) ผงของสังกะสี (Wikipedia, the free encyclopedia, Zinc oxide. 2007) และ (b) โครงสร้างผลึก wurtzite (ศศิธร ยะดา, 2549)

มีจุดหลอมเหลว $1,975 \text{ }^{\circ}\text{C}$ สามารถใช้งานได้หลากหลาย อาทิ เป็นส่วนผสมรวมกับ เหล็กออกไซด์ (iron(III) oxide, Fe_2O_3) ใช้ใน calamine lotion เป็นส่วนผสมรวมกับ stearic acid ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยา膏พารา (Wikipedia, the free encyclopedia, Zinc oxide. 2007) นอกจากนี้สังกะสีออกไซด์ ยังเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ประเภท direct band gap มีช่องว่างพลังงาน 3.37 eV ที่อุณหภูมิห้อง ใช้งานเป็นเซนเซอร์ตรวจจับแสง (Photodetector) (Z.L. Wang, 2004) อุปกรณ์แปลงความถี่ (Frequency converter) ไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ที่ให้แสงในช่วงความยาวคลื่นของสีฟ้า (Wikipedia, the free encyclopedia, Zinc oxide. 2007 and D.P. Norton, 2004) ซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้เป็นหัวอ่านของเครื่องอ่านสือบันทึกต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถลดข้อจำกัดของพื้นที่หน่วยความจำในการผลิตแผ่น CD หรือ DVD เรียกว่า Blue ray เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทโซนีแสดงดังรูป

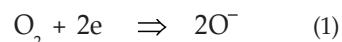


รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเทคโนโลยีสื่อบันทึก CD, DVD และ Blue ray (One Point Storage Systems, *Informationsseite zur Verbatim Blu-ray Disk*. 2006.)

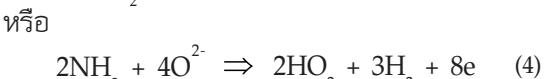
จะเห็นได้ว่าความยาวคลื่นของเลเซอร์ที่ใช้อ่านแผ่น CD และ DVD นั้นมีผลต่อกำไรจุของแผ่นด้วย ในเทคโนโลยี CD จะใช้เลเซอร์ความยาวคลื่นประมาณ 780 nm ทำให้กำไรจุของแผ่น CD มีแค่ 700 MB เท่านั้น เทคโนโลยี DVD ใช้เลเซอร์ความยาวคลื่นประมาณ 650 nm ได้กำไรจุเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 GB แต่ในเทคโนโลยีของ Blue ray ใช้เลเซอร์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำสังกะสีออกไซด์ ให้แสงในยานสีฟ้า มีความยาวคลื่นประมาณ 405 nm ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทั้ง 2 เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ลดขนาดของ ร่อง หรือ จุด ในการบันทึกข้อมูลลงได้มากจนทำให้กำไรจุของแผ่น Blue ray มีค่าสูงถึง 25 GB (*One Point Storage Systems, Informationsseite zur Verbatim Blu-ray Disk*. 2006.)

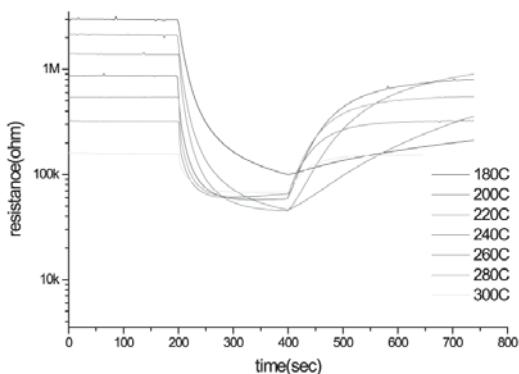
พิล์มบางโปร่งแสงที่เคลือบด้วยสังกะสีออกไซด์ ใช้สำหรับสร้างเฉลี่ล์แสงอาทิตย์นิodicสารอินทรีย์กำลัง มีการริจอย่างหลักหลาย ซึ่งรวมถึงการผลิตเป็นจอ LCD ชั้นไฟฟ้า (D.P. Norton, 2004) นอกจานี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นแม่เหล็กประภากเพร์โซ (ferromagnetism) ที่เอื้อต่อการใช้งานเป็นหน่วยความจำในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นสาร

เพียงชิ้นเล็กๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เครื่องอัลตราโซนิกส์ ไมโครโฟน เป็นต้น (Wikipedia, the free encyclopedia, Zinc oxide. 2007) และสังกะสีออกไซด์ยังมีคุณสมบัติในการตรวจวัดความชื้น (Y. Zhang, 2005) และตรวจวัดก๊าซได้อีกด้วย (ศศิธร ยะดา, 2549) สำหรับเชนเชอร์ตรวจวัดก๊าชนั้นส่วนมากอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงของสภาพการนำไฟฟ้าของหัววัดเมื่อยื่นในบรรยายกาศของก๊าชที่ต้องการตรวจวัด สังกะสีออกไซด์เป็นสารเคมีจำพวกโลหะออกไซด์ ซึ่งปกติที่ผิวของโลหะออกไซด์จะมีก๊าชออกซิเจนจากอากาศมาจับกัน ตำแหน่งที่ขาดออกซิเจน (oxygen vacancies) ก๊าชออกซิเจนจะดึงเอาอิเล็กตรอนจากผิวออกไปและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนลบ O^- หรือ O^{2-} ดังสมการที่ (1) และ (2)



ไอออนลบนี้จะมาจับอยู่ที่ผิวของโลหะออกไซด์ทำให้เกิดกำแพงศักย์สั่งผลให้การนำไฟฟ้าของโลหะออกไซด์ลดลง เมื่อมีก๊าชที่ต้องการตรวจวัดเข้ามาในบริเวณผิวของโลหะออกไซด์ เช่น ไฮโดรเจน (H_2) หรือ แอมโมเนียม (NH_3) ก๊าชเหล่านี้จะรวมตัวกับออกซิเจนที่บริเวณผิวแล้วหลุดออกไปเกิดเป็นก๊าชชนิดใหม่และจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมายังสมการ (3) และ (4) ทำให้การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้จะขึ้นกับอุณหภูมิ และแตกต่างกันไปตามชนิดของก๊าช (W. Gopel, 1999)





รูปที่ 3 หัววัดก้าชที่ผลิตจาก ZnO และกราฟของความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ณ อุณหภูมิต่างๆ ในขณะที่ตรวจจับก้าชເວທານອล (ศศิธร ยะดา, 2549)

ในรูปที่ 3 เป็นตัวอย่างหัววัดก้าชที่ผลิตจากอนุภาคนanoสังกะสีออกไซด์ และกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิต่างๆ เมื่อยื่นในบรรยากาศของເວທານອล ด้วยคุณสมบัติที่ดีและหลากหลายของสังกะสีออกไซด์ดังที่กล่าวมานี้ ทำให้สารชนิดนี้เป็นที่สนใจและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในหลายๆ ด้าน เช่นนักวิจัยทั่วโลกได้ดำเนินการวิจัยกันอยู่ในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้งานอนุภาคนanoของ GaN, ZnO และ SnO₂ แสดงในตารางที่ 1 (P.J Pauzauskie, 2006)

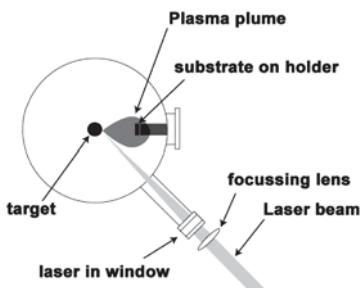
ตารางที่ 1 แสดงการประยุกต์ใช้งานລວດນາโนที่สังเคราะห์ได้จาก GaN, ZnO และ SnO₂

Nanowires	Optical functions	Characteristics
GaN	Nanolaser Light-emitting diodes	Emission wavelength: 370-390 nm Threshold: ~ 500 nJ/cm ² Cavity Q factor: 500-1500 Threshold gain: 400-1000 cm ⁻¹ Emission wavelength: 380-420 nm
ZnO	Nanolaser Frequency converter Solar cell Photodetector	Emission wavelength: 370-400 nm Threshold: > 70 nJ/cm ² Cavity Q factor: 1000-1500 Threshold gain: 1000-3000 cm ⁻¹ Effective second-order susceptibility: 5.5 pm/V Energy converting efficiency: 3.5% UV light detector
SnO ₂	Waveguide Evanescence wave optical sensor	Propagation loss: 1-8 dB mm ⁻¹ Single molecular level detection

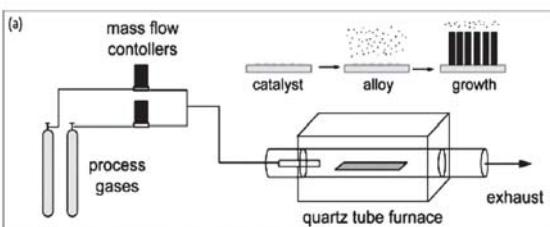
โดยทั่วไปแล้ว มีความจำเป็นต้องสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ให้เป็นผลึกขนาดเล็กก่อนที่จะนำไปใช้งาน โดยเฉพาะการนำไปสร้างเป็นหัววัดก้าช เนื่องจากเมื่อขนาดของอนุภาคเล็กลงพื้นที่ผิวจะเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อการใช้งานตรวจจับก้าชต่างๆ วิธีการสังเคราะห์ที่กล่าวถึงนี้มีอยู่หลายวิธี อาทิ Chemical vapor depositions (A. Umar, 2005), Wet chemical (J. Lui, 2005), Hydrothermal (G.H. Yue, 2006), Thermal evaporation (C. Li, 2006), Oxidation

(ศศิธร ยะดา, 2549), Sputtering (S. Choopan, 2005), Current heating deposition (P. Singjai, 2007.), Solution calcination process (H. Nui, 2007), Texture self-assembly (Z.L. Wang, 2004) และ modified chemical bath deposition (H. Wang, 2006) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ในการสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ในระดับจุลภาค (นาโนเมตร-ไมโครเมตร) มีค่าใช้จ่ายสูง จำเป็นต้องควบคุมตัวแปรต่าง ๆ หลายอย่างให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความดัน บรรยากาศใน

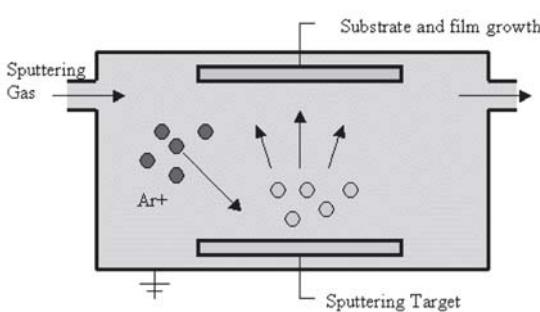
ขณะทำการสังเคราะห์สารตั้งต้น substrate การเติมสารเจือปัจจัยต่างๆ เหล่านี้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนการสังเคราะห์อย่างมาก ตัวอย่างกระบวนการในสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ได้แก่ Pulse laser deposition, Vapor deposition และ Sputtering แสดงดังรูป 4-6



รูปที่ 4 แสดงเครื่องมือในการสังเคราะห์ด้วยวิธี Pulse Laser depositions (Wikipedia, the free encyclopedia, Pulse Laser depositions. 2007)



รูปที่ 5 แสดงเครื่องมือในการสังเคราะห์ด้วยวิธี Vapor depositions (P.J Pauzauskie, 2006)

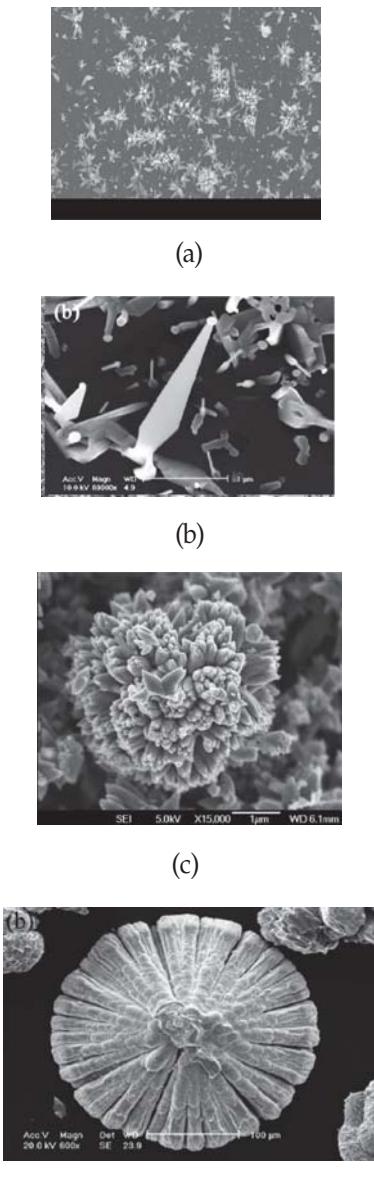


รูปที่ 6 แสดงเครื่องมือในการสังเคราะห์ด้วยวิธี Sputtering method (Wikipedia, the free encyclopedia, Sputter deposition. 2007)

ในการสังเคราะห์โดยอาศัยวิธี Pulse laser deposition จะทำในสภาพความดันต่ำโดยการใช้แสงเลเซอร์ยิงไปยังสารตัวอย่างให้เกิดความร้อนทำให้ออกตอนของสารตัวอย่างหลุดออกจากและอยู่ในสภาพ plasma และเคลือบบนผิว substrate ส่วนวิธี Chemical vapor deposition จะวาง substrate ไว้ในเตาเผาแล้ว่นให้สารตัวอย่างเข้าไปในเตาที่มีอุณหภูมิสูงร่วมกับก๊าซเนื้อยี่ เช่น าร์กอน ออกซิเจน หรือไนโตรเจน เมื่อได้รับความร้อนสารตัวอย่างจะควบแน่นเกิดการตกตะกอนเป็นของแข็งเคลือบบน substrate ที่วางไว้สำหรับวิธี Vapor deposition นั้นจะคล้ายคลึงกับ Chemical vapor deposition เพียงแต่จะนำสารตัวอย่างใส่ไปในเตาเผาตั้งแต่เริ่มต้นโดยสารตัวอย่างอาจจะอยู่ในรูปของ ผง เม็ดสาร หรือ ของเหลว ก็ได้ การสังเคราะห์โดยวิธี Sputtering จะทำในบรรยากาศของก๊าซเนื้อยี่ความดันต่ำ โดยนำสารตัวอย่างไปอัดเป็นเม็ดนำไปวางเป็นเป้า เพื่อให้อุณหภูมิของก๊าซเนื้อยี่ที่ทำหน้าที่เป็น ลูกกระสุนเมื่อยู่ในสภาพพลาสม่า (plasma) ยิงใส่เป้าให้ผิวน้ำของสารตัวอย่างตกลงมาเคลือบบน substrate ที่วางไว้ใต้สารตัวอย่าง โดยอาศัยแรงทางไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงเป็นตัวเร่งอนุภาคกระสุนและดึงให้สารตัวอย่างเคลือบบนผิวตามลำดับกระบวนการ Current heating deposition นั้น อาศัยการเผาสารตัวอย่าง ด้วยความร้อนสูงโดยการให้กระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่มีค่าสูง สามารถทำได้ในบรรยากาศของก๊าซเนื้อยี่ที่สภาวะความดันปกติ เมื่อสารตัวอย่างได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไปแล้วควบแน่นเป็นผลึกที่บริเวณผิว ในการสังเคราะห์พบว่า อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับจุลภาคที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันหลากหลายแบบ อาทิ nanowires (S.C. Lyu, 2002), nanostars (A. Umar, 2005), nano necktie-likes (J.K Jian, 2006),

nano porous (H. Wang, 2006), nanobelts (S. Choopan, 2005), nanocombs (Y.Q. Chen, 2005), nanoflowers (J. Lui, 2005), nanomushroom-likes (N. Hiu, 2007), nanocages, nanorings, nanospirals, nanohelixs, nanopropeller (Z.L. Wang, 2004) และอื่นๆ ตัวอย่างของอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ แสดงดังต่อไปนี้

ดังรูป 7 – 8

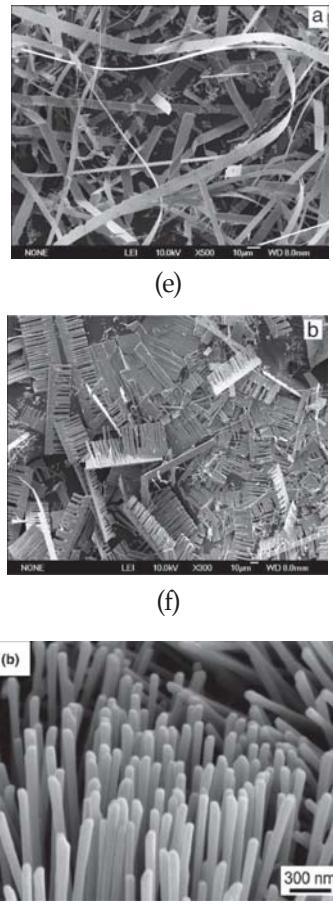


(a)

(b)

(c)

(d)



(e)

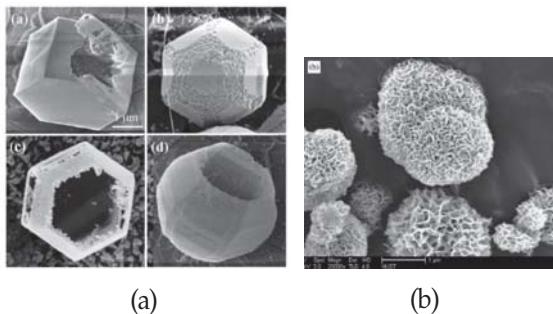
(f)

(g)

(h)

รูปที่ 7 (a) nanostars สังเคราะห์จากวิธี CVD (A.Umar, 2005) (b) nano necktie-likes สังเคราะห์จากวิธี Vapor transport deposition (J.K. Jian, 2006) (c) nanoflowers สังเคราะห์จากวิธี Wet chemical (J. Lui, 2005) (d) mushroom-like nanoparticles สังเคราะห์จากวิธี Solution calcinations (H. Niu, 2007) (e) microbelts (f) microcombs สังเคราะห์

จากวิธี Direct thermal evaporation (Y.Q. Chen, 2005) (g) nanowires สังเคราะห์จากวิธี Oxidation (S.C. Lyu, 2002) และ (h) nanopropeller (Z.L. Wang, 2004)



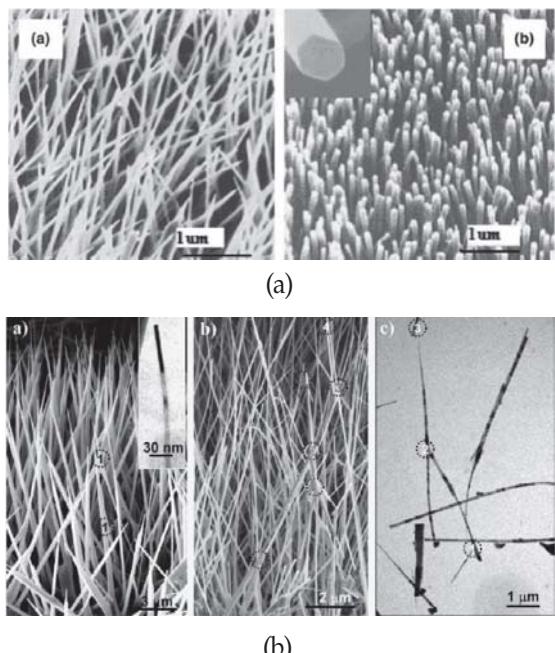
รูปที่ 8 (a) nanocages สังเคราะห์จากวิธี Texture self-assembly (Z.L. Wang, 2004) (b) nanoporous สังเคราะห์โดยวิธี Via a modified chemical bath deposition method (H. Wang, 2006)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการสังเคราะห์อนุภาค สังกะสีออกไซด์ในระดับนาโนนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสังเคราะห์ซึ่งต้องควบคุมให้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย สารตั้งต้น อัตราการไหลของกําช substrate ที่ใช้รองรับ อุณหภูมิ ระยะเวลา เเละความดันของบรรยากาศ และสารเคมีที่ใช้เร่งปฏิกิริยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สารตั้งต้น

สารตั้งต้น เป็นปัจจัยหลักที่มีผลโดยตรงต่อการสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ในระดับจุลภาค เนื่องจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี การดูดกลืน การแพร่ของอะตอนหรือโมเลกุลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบ จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และกรรมวิธีการสังเคราะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น P.X. Gao และคณะ (P.X. Gao, 2005) สังเคราะห์ nanowires จากวิธี evaporation ใช้ ZnO เป็นสารตั้งต้น ในขณะที่

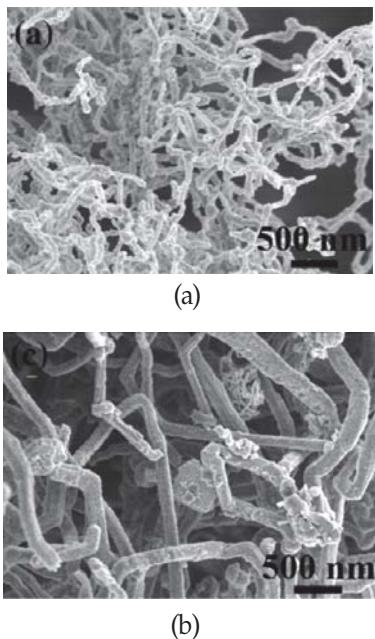
X.Q. Meng (X.Q. Meng, 200) ใช้ผง Zn และกําช O₂ สังเคราะห์โดยวิธี Oxidation nanowires ที่สังเคราะห์ได้จากทั้ง 2 วิธี แสดงดังรูป 9



รูปที่ 9 รูป (a) จากงานวิจัยของ X.Q. Meng (X.Q. Meng, 2005) รูป (b) จากงานวิจัยของ P.X. Gao (P.X. Gao, 2005)

2. อัตราการไหลของกําชที่ไฟลผ่านในขณะสังเคราะห์

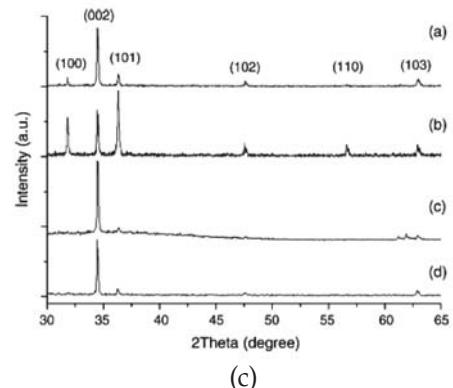
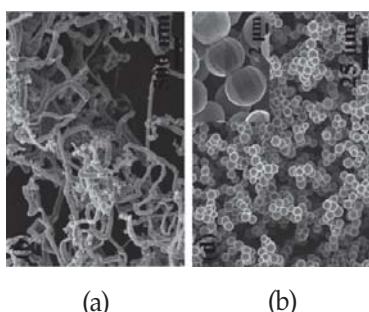
การสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์หรือโลหะออกไซด์ชนิดอื่น จะใช้กําชเฉื่อยหรือกําชชนิดอื่นเข้าไปในเตาเผาเพื่อໄล่อากาศหรือเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างพลิก อาทิ กําชอาร์กอน ในโทรเจน ออกซิเจนเป็นต้น Y.J. Chen และคณะ (Y.J. Chen, 2007) ได้สังเคราะห์เส้นลวดนาโนของสังกะสีโดยให้กําชในโทรเจนที่มีอัตราการไหลแตกต่างกัน พบว่า อัตราการไหลของกําชในโทรเจนมีผลต่อขนาดของเส้นลวด นานาในที่สังเคราะห์ได้ เมื่อใช้อัตราการไหลของกําชสูงขนาดของเส้นลวดนาโนจะเล็กกว่าเมื่อใช้อัตราการไหลของกําชต่ำ แสดงดังรูป 10



รูปที่ 10 แสดงผลของอัตราการ flow N₂ ที่มีต่อขนาด Zn nanowires (a) ใช้อัตราการ flow 1000 ml/min (b) 200 ml/min (Y.J. Chen, 2007)

3. Substrate ที่ใช้รองรับ

Substrate ที่ใช้รองรับสารตัวอย่างในระหว่างการสังเคราะห์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังเช่นที่ Y.J. Chen และคณะ (Y.J. Chen, 2007) ได้รายงานไว้ว่า ในระหว่างการสังเคราะห์เส้น楞ดนาโนของสังกะสีโดยใช้ อลูมินา ควรตั้ง และ stainless-steel foil พบว่า ไม่สามารถสังเคราะห์เส้น楞ดนาโนของสังกะสีได้บน stainless-steel foil ผลของ substrate แสดงดังรูป 11



รูปที่ 11 แสดงผลของ Substrate ที่มีลักษณะ Zn nanoparticles รูป (a) ใช้ Al₂O₃ รูป (b) เป็น stainless-steel foil (Y.J. Chen, 2007) รูป (c) เป็น XRD pattern ที่ได้จากการใช้ substrate ต่างกัน (a) Si (100) (450 °C) (b) glass (450 °C) (c) Si (100) (480 °C) และ (d) glass (480 °C) (D.H. Liu, 2005)

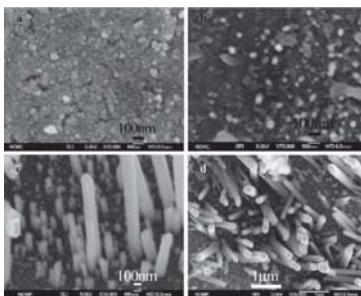
4. อุณหภูมิ

บางวิธีจะใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์สูง (ประมาณ 1,000 °C) ในบางวิธีใช้อุณหภูมิต่ำมาก หรือไม่มีการควบคุมอุณหภูมิเลยก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้น กระบวนการที่ใช้ เป็นต้น เช่น ในงานวิจัยของ X. Xing และคณะ (X. Xing, 2006) โดยวิธี modified chemical vapor deposition (MOCVD) ใช้ ผงของ ZnO และ C เป็นสารตั้งต้น ใช้อุณหภูมิการเผา 900 °C ในขณะที่ X. Hou (X. Hou, 2006) และคณะสังเคราะห์ ZnO nanorod ที่อุณหภูมิ 60 °C โดยอาศัยวิธี solid state reaction

5. ระยะเวลา

การเกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม สมค่าหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธี อุณหภูมิ สารตั้งต้น หรือปัจจัยอื่น ดังเช่นงานวิจัยของ D. Wang และคณะ (D. Wang, 2007) สังเคราะห์ ZnO nanoprisms ด้วยวิธี Wet chemical และศึกษาผลของเวลาที่

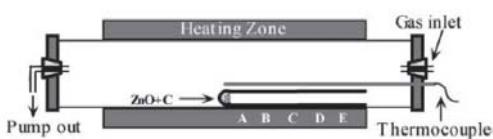
ทำปฏิกิริยาต่อสารที่สังเคราะห์ได้ พบร่วม เวลาที่ใช้มีผลโดยตรงต่อลักษณะกายภาพของ ZnO nanoprisms กล่าวคือ ความยาวของผลึกแปรตามระยะเวลาที่ใช้แสดงดังรูป 12



รูปที่ 12 แสดงผลของ เวลาในการสังเคราะห์ Zn nanoprisms (a) 2h (b) 3h (c) 4 h และ (d) 5h ตามลำดับ (D. Wang, 2007)

6. ความดันของบรรยากาศ

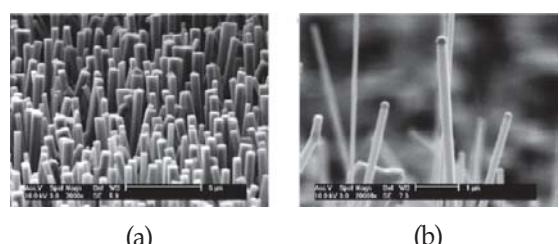
ในบางวิธีที่ใช้สังเคราะห์วัสดุในระดับจุลภาค พบร่วม ความดันบรรยากาศทั้งบรรยากาศปกติและกําชชันนิดต่างๆ มีผลต่อสมบัติของสารที่สังเคราะห์ได้ทั้งขนาด รูปร่าง และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังเช่น ในงานวิจัยของ P.T. Hsien และคณะ (P.T. Hsien, 2006) สังเคราะห์ ZnO film ด้วยวิธี RF magnetron sputtering ที่ความดันบรรยากาศของกําชavar'กอน 2×10^{-6} Torr ในขณะที่ A. Umar และคณะ (A. Umar, 2005) สังเคราะห์ ZnO particles ด้วยวิธี CVD ใช้ความดัน 3 Torr ตัวอย่างการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสังกะสีออกไซด์ที่ควบคุมความดันบรรยากาศแสดง ดังรูป 13



รูปที่ 13 เครื่องมือสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยวิธี Thermal evaporation ที่มีการควบคุมความดันในเตาเผา (C. Li, 2006)

7. สารเคมีที่ใช้เร่งปฏิกิริยา

มีรายงานการวิจัยหลายชิ้น ที่รายงานว่าใช้สารเคมีอื่นช่วยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์ให้ได้ดี 例如 ในระดับจุลภาค เช่น K. Yamamoto และคณะ (K. Yamamoto, 2004) ใช้ Cu เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการปลูกผลึก ZnO nanowires ด้วยวิธี Evaporation ในงานวิจัยของ Y. Zhang และคณะ (Y. Zhang, 2005) และ Y.S. Lim และคณะ (Y.S. Lim, 2006) ใช้ Au เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นต้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้สังเคราะห์เป็นหลักเนื่องจากงานวิจัยบางส่วนก็ไม่ได้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยแต่อย่างใด ดังเช่นงานวิจัยของที่ A. Umar และคณะ (A. Umar, 2005) สังเคราะห์ ZnO nanoparticles ด้วยวิธี CVD และ A. Sekar และคณะ (A. Sekar, 2005) สังเคราะห์ ZnO nanowires จากวิธี Oxidation ผลของการใช้ Au เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังรูป 14



(a)

(b)

รูปที่ 14 เปรียบเทียบ Zn nanowires (a) ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา และ (b) ใช้ Au เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งพบอนุภาค Au ที่ปลายบนสุดของ ZnO nanowires (X. Xing, 2006)

ในขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศไทยกำลังศึกษา วิจัย และพยายามนำเอาอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์นี้มาใช้งานให้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าอีกไม่นานเราจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากสังกะสีออกไซด์นี้อยู่ใกล้ๆ กับเรา

เอกสารอ้างอิง

1. ศศิธร ยะถาน. (2549). การเตรียมเซนเซอร์ เอกานอลที่เตรียมจากเส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่ผสมด้วยแพลทินัมและอนุภาคนาโนของทองคำ. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2. Chen, Y.J., Chi, B., Zhang, H.Z., Chen, H. & Chen, Y. (2007). Controlled growth of zinc nanowires. *Mat. Letters.* (61), 144-147.
3. Chen, Y.Q., Jiang, J., He, Z.Y., Su, Y., Cai, D. & Chen, L. (2005). Growth mechanism and characterization of ZnO microbelts and Self-assembled microcombs. *Mat. Letters.* (59), 3280-3283.
4. Choopan, S., Hongsith, N., Tanunchai, S., Chairuangsri, T., Krua-in, C., Singkarat, S., Vilaithong, T., Mangkorntong, P. & Mangkorntong, P. (2005). Single-Crystalline ZnO Nanobelts by RF Sputtering. *J. Crystal Growth.* (282), 365-369.
5. Gao, P.X., Lao, C.S., Hughes, W.L. & Wang, Z.L. (2005). Three-dimensional interconnected nanowire networks of ZnO. *Chem. Phys. Letters.* (408), 174-178.
6. Gopel, W., Hese, J. & Zemel J.N. (1999). *Sensor a Comprehensive Survey*. Vol. 2, Weinheim : VCH Publication.
7. Hou, X., Zou, F. & Liu, W. (2006). A facile low-cost synthesis of ZnO nanorods via a solid-state reaction at low temperature. *Mat. Letters.* (60), 3786-3788.
8. Hsieh, P.T., Chen, Y.C., Wang, C.M., Tsai, Y.Z. & Hu, C.C. (2006). Structural and photoluminescence characteristics of ZnO films by room temperature sputtering and rapid thermal annealing process. *Appl. Physics A.* (84), 345-349.
9. Jian, J.K., Wang, C., Zhang, Z.H., Chen, X.L., Xu, L.H. & Wang, T.M. (2006). Necktie-like ZnO nanobelts grown by a self-catalytic VLS process. *Mat. Letters.* (60), 3809-3812.
10. Li, C., Fang, G., Fu, Q., Su, F., Li, G., Wu, X. & Zhao, X. (2006). Effect of substrate temperature on growth and photoluminescence properties of vertically aligned ZnO nanostructures. *J. Crystal Growth.* (292), 19-25.
11. Lim, Y.S., Park, J.W., Hong, S.T. & Kim, J. (2006). Carbothermal synthesis of ZnO nanocomb structure. *Mat. Sci. Engineering B.* (129), 100-103.
12. Liu, D. H., L. Liao, Li J. C., Guo, H. X. & Fu, Q. (2005). Preparation and Photoluminescence of ZnO Nanostructures by Thermal Evaporation Growth without Catalysts. *Mater. Sci. Eng. B.* (121), 77-80.
13. Liu, J., Huang, X., Duan, J., Ai, H. & Tu, P. (2005). A low-temperature synthesis of multiwhisker-based zinc oxide micron crystals. *Mat. Letters.* (59), 3710-3714.
14. Lyu, S.C., Zhang, Y., Ruh, H., Lee, H.J., Shim, H.W., Suh, E.K. & Lee, C.J. (2002). Low temperature growth and photoluminescence of wellaligned zinc oxide nanowires. *Chem. Phys. Letters.* (363), 134-138.
15. Niu, H., Yang, Q., Yu, F., Tang & K., Xie, Y.

- (2007). Formation of mushroom-like ZnO microcrystals through a solution calcination process. **Mat. Letters.** (61), 137-140.
16. Meng, X.Q., Zhao, D.X., Zhang, J.Y., Shen, D.Z., Lu, Y.M., Lui, Y.C. & Fan, X.W. (2005). Growth temperature controlled shape variety of ZnO nanowires. **Chem. Phys. Letters.** (407), 91-94.
17. Pauzauskie, P.J. & Yang, P. (2006). Nanowire photonics. **Materials Today.** (9), 36-45.
18. Sekar, A., Kim, S.H., Umar, A. & Hahn, Y.B. (2005). Catalyst-Free Synthesis of ZnO Nanowires on Si by Oxidation of Zn powders. **J. Crystal Growth.** (277), 471-478.
19. Singjai, P., Jintakosol, T., Singkarat, S. & Choopan, S. (2007). Luminescence properties and larg-scale production of ZnO nanowires by current heating deposition. **Mat. Sci. Engineering B.** (137), 59-62.
20. Umar, A., Kim, S.H., Lee, Y.S., Nahm, K.S. & Hahn, Y.B. (2005). Catalyst-free large-quantity synthesis of ZnO nanorods by a vapour-solid growth mechanism: Structure and optical properties. **J. Crystal Growth.** (282), 131-136.
21. Wang, D., Song, C., Hu, Z., Chen, W. & Fu, X. (2007). Growth of ZnO prism on self-source substrate. **Mat. Letters.** (61), 205-208.
22. Wang, H. & Xie, C. (2006). Controlled fabrication of nanostructured ZnO particles and porous thin films via a modified chemical bath deposition method. **J. Crystal Growth.** (291), 187-195.
23. Wang, Z.L. (2004). Nanostructures of zinc oxide. **Materials Today.** (7), 26-33.
24. Xing, X., Zheng, K., Xu, H., Fang, F., Shen, H., Zhang, J., Zhu, J., Ye, C., Cao, G., Sun, D. & Chen, G. (2006). Synthesis and electrical properties of ZnO nanowires. **Micron.** (37), 370-373.
25. Yamamoto, K., Nagasawa, K. & Ohmori, T. (2004). Preparation and characterization of ZnO nanowire. **Physica E.** (24), 129-132.
26. Yue, G.H., Yan, P.X., Yan, D., Fan, X.Y., Wang, M.X., Qu, D.M. & Liu, J.Z. (2006). Hydrothermal synthesis of single-crystal ZnS nanowires. **Appl. Physics A.** (84), 409-412.
27. Zhang, Y., Yu, K., Jiang, D., Zhu, Z., Geng, H. & Luo, L. (2005). Zinc oxide nanorod and nanowire for humidity sensor. **Appl. Surf. Science.** (242), 212-217.
28. One Point Storage Systems. (2006). **Informationsseite zur Verbatim Blu-ray Disk.** Retrieved May 8, 2007 from the World Wide Web : <http://www.onepoint.de/Verbatim%20Blu%20ray/Verbatim%20Blu%20ray.htm>
29. Wikipedia, the free encyclopedia. (2007). **Sputter deposition.** Retrieved May 11, 2007 from the World Wide Web : http://en.wikipedia.org/wiki/Sputter_deposition
30. Wikipedia, the free encyclopedia. (2007). **Zinc oxide.** Retrieved May 8, 2007 from the World Wide Web : http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide#Applications